

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成30年12月27日 (2018.12.27)

【公開番号】特開2017-199823(P2017-199823A)

【公開日】平成29年11月2日 (2017.11.2)

【年通号数】公開・登録公報2017-042

【出願番号】特願2016-90189(P2016-90189)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/00 (2006.01)

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

H 0 5 K 1/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/00 A

H 0 1 L 23/12 F

H 0 5 K 1/02 R

【手続補正書】

【提出日】平成30年11月13日 (2018.11.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 7】

支持基材 1 0 0 の粗化について、より詳細に説明する。支持基材 1 0 0 に S U S 基材を用いる場合、S U S 基材の表面は不動態化されている。ここで、上記のエッチャントに含まれる C u イオンは S U S 基材中の F e、C r、N i の少なくとも 1 つと置換されることで S U S がエッチングされる。しかし、S U S のエッチングは局所的に進行するため不均一にエッチングされ、エッチング後の S U S 表面の凹凸が大きくなる。つまり、図 4 に示す状態でエッチャントに浸漬することで、S U S 基材の裏面及び側面を同一処理で粗化することができる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1 B

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 1 B】

10